

10; 11; 12

© 1991

СИНТЕЗ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ α -Fe С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОННО-ЛУЧЕВОГО СМЕШИВАНИЯ И ПРЯМОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Л.П. Чупякова, И.Г. Мурзин,
Т.Е. Пекшева, И.А. Комаровский

Традиционными методами формирования тонких пленок нитридов Al и Fe являются реактивные магнетронное напыление [1], ионно-лучевое распыление [2], ионное покрытие [3] и молекулярно-лучевая эпитаксия [4]. Однако в большинстве из них используется высокая температура процесса, а полученные покрытия нуждаются в последующей термообработке. Для низкотемпературного синтеза нитридов в поверхности может быть предложена прямая высокодозная имплантация ионов азота в обрабатываемые металлы [5-8]. Сформированные таким образом нитриды обладают высокими механическими характеристиками, в частности, высокой твердостью, что делает возможным создание на их основе новых износостойких материалов [9].

Целью данной работы является формирование на поверхности α -Fe покрытия AlN с использованием следующих методов: 1) ионно-лучевого смешивания (ИЛС) для повышения адгезии к основе [10, 11]; 2) прямой ионной имплантации для синтеза соединения [5-8].

В экспериментах использовали механически полированные образцы α -Fe с тонкопленочными покрытиями Al. Пленки Al толщиной 100 нм наносили методом магнетронного напыления. Перед нанесением пленки поверхность образцов подвергалась ионно-плазменной очистке. Имплантация проводилась на установке High Voltage Engineering BV в два этапа - сначала ионами Ar⁺ с энергией 120 кэВ и дозой $D = 3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$, а затем - ионами N₂⁺ с E = 50 кэВ и $D = 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$. Ожеэлектронная спектроскопия (ОЭС) с послойным травлением применялась для получения распределений концентраций основных элементов (Al, Fe, N, O, C) по глубине образца. Для исследования структуры имплантированных слоев использовался метод просвечивающей электронной микроскопии.

Выбор описанных выше режимов имплантации основан на моделировании с помощью программы TRIM [12] торможения ионов Ar⁺ и N₂⁺ в исходном двухслойном образце. На рис. 1, а приведены рассчитанные профили энергии E_n, внесенной в упругих столкновениях с атомами мишени. Видно, что энергия E_n, вносимая ионами N₂⁺ (кривая 1), теряется в тонкой пленке Al, не

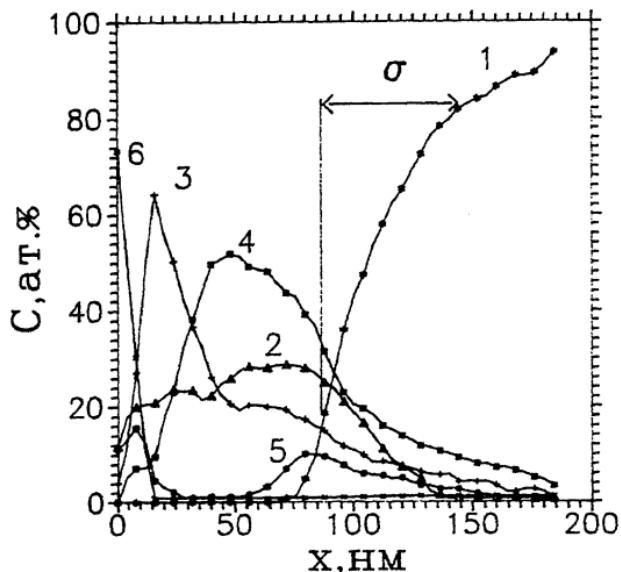


Рис. 1. Результаты моделирования торможения ионов Ar^+ и N_2^+ в α -Fe с алюминиевым покрытием толщиной 100 нм. На рис. 1, а кривые 1, 2 обозначают профили энергии E_n , внесенной ионами Ar^+ и N_2^+ в упругих столкновениях с атомами мишени, соответственно; на рис. 1, б кривые 3, 4 относятся к экспериментальному и рассчитанному распределению концентрации N внедренного азота как функции глубины x соответственно.

способствуя перемешиванию атомов Al и Fe . Создание перемешанного слоя обеспечивается облучением более тяжелыми ионами Ar^+ , так как максимум распределения E_n (кривая 2) приходится на внутреннюю границу двухслойного образца, что является необходимым условием технологии ИЛС [10, 11].

Характер распределения основных элементов и ширину перемешанного слоя δ [10, 11] после облучения определяли из данных ОЭС, представленных на рис. 2. Взаимное проникновение Al и Fe происходит равномерно, а величина δ составляет ≈ 50 нм.

Для синтеза AlN использовали прямую имплантацию N_2^+ в поверхность, модифицированную ИЛС. Как видно из рис. 1, б, средний проекционный пробег R_p ионов азота составлял ≈ 50 нм и почти весь внедренный азот оставался в пленке Al . Максимальная концентрация азота составляла ≈ 54 ат.%. Экспериментальный и рассчитанный профили (кривые 3 и 4 соответственно) практически совпадают за исключением участков, соответствующих интервалам глубин от 0 до 20 нм и от 100 до 180 нм, что связано с наличием на поверхности тонкого слоя окисла и массопереносом азота вглубь основы за счет ее разогрева при облучении соответственно.

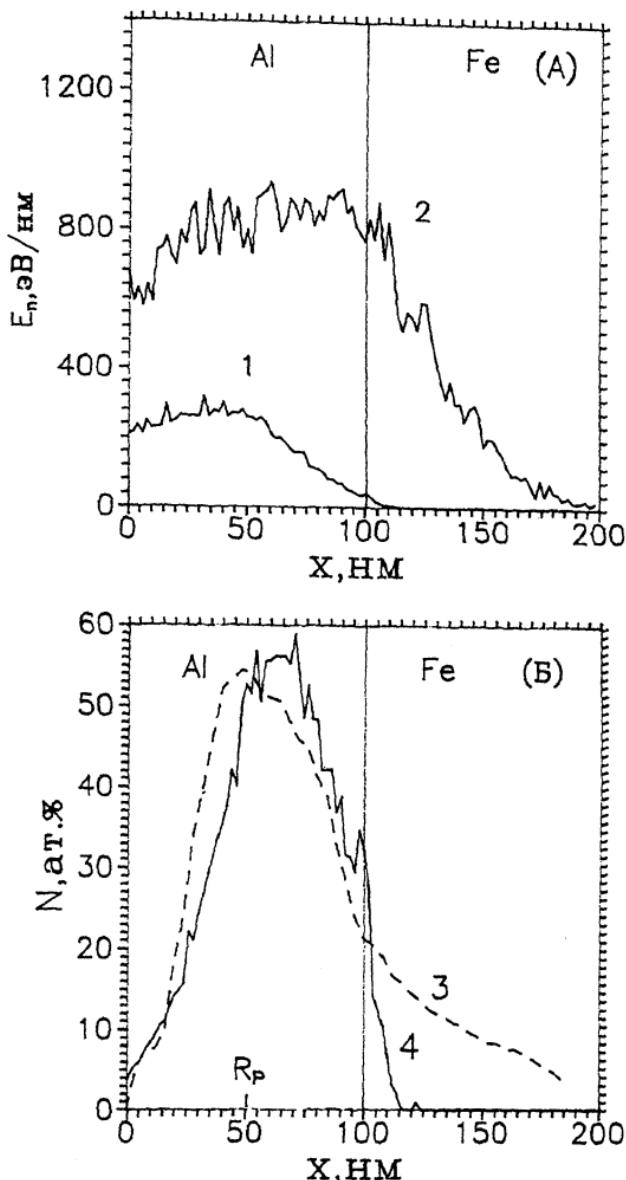


Рис. 2. Зависимость концентрации С основных элементов от глубины образца x после имплантации Ar^+ и N_2^+ . 1 - Fe , 2 - Al , входящий в состав нитрида, 3 - Al , 4 - N , 5 - O , 6 - C .

Об образовании фазы AlN свидетельствует корреляция (рис. 2) между профилем Al , входящего в состав нитрида (кривая 2) и профилем азота (кривая 4). Данный результат был подтвержден путем электронно-микроскопического исследования поперечного среза имплантированного образца на просвет. В результате расшифровки картин микродифракции установлено, что в модифицированном облучением покрытии присутствуют поликристаллические слои Al и его нитрида.

Результаты предварительных испытаний износостойкости свидетельствуют о ее увеличении в 3–4 раза по сравнению с необработанными образцами.

Таким образом, в данной работе показано, что прямая высокодозная имплантация в сочетании с ИЛС может успешно применяться для формирования износостойких покрытий *AlN* на поверхности железа.

Список литературы

- [1] Ohuchi F.S., Russell P.E. // J. Vac. Sci. & Technol. 1987. V. A5. N 4. P. 1630–1635.
- [2] Erler H.-J., Reisse G., Weissmantel C. // Thin Solid Films. 1980. V. 65. N 2. P. 233–238.
- [3] Murrayama Y., Kashiwagi K. // J. Vac. Sci. & Technol. 1980. V. 17. N 4. P. 796–801.
- [4] Oshida S., Misawa S., Gonda S. // J. Vac. Sci. & Technol. 1983. V. B1. N 2. P. 250–255.
- [5] Chatterjee P., Batabyal A.K. // Thin Solid Films. 1989. V. 169. N 1. P. 79–86.
- [6] Ohira S., Iwaki M. // Mat. Sci. & Eng. 1987. V. 90. N 1. P. 143–148.
- [7] McCune R.C., Donlon W.T., Plummer H.K., Toth Js.L., Kunz F.W. // Thin Solid Films. 1989. V. 168. N 2. P. 263–280.
- [8] Lieske N., Hezel R. // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. N 9. P. 5806–5810.
- [9] Charman G.E., King B.V., Mac Donald R.J. // Nucl. Instr. & Meth. in Phys. Res. 1989. V. B39. N 2. P. 535–539.
- [10] Чупярова Л.П., Комаровский И.А., Мурзин И.Г., Пекшева Т.Е. // Поверхность. 1991. № 6. С. 133–145.
- [11] Choupyatova L.P., Komarovskiy I.A., Murzin I.G., Videenskaya T.E. 3rd International Conference on Energy Pulse and particle beam modification of materials. Dresden, GDR, 4–8 sept. 1989.
- [12] Ziegler J.F., Biersack J.P., Littmark U. The stopping and range of ion in solids. New York: Pergamon, 1985. V. 1. Edited by Ziegler J.F., P. 314.

Поступило в Редакцию
5 июля 1991 г.